

Pressa Isostatica Elettrica 40 Tonnellate Automatica Per Compattazione Polveri Da Laboratorio

Numero articolo: PWDC



introduzione

Ottimizza la ricerca sui materiali con questa pressa isostatica elettrica di prima qualità per la compattazione di polveri da laboratorio, dotata di controllo con touch screen intelligente e protezione di sicurezza integrata, per la produzione di provini ad alta densità costante in diversi settori industriali e ambienti di ricerca accademica avanzata.

Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio principale
Ricerca sulle batterie a stato solido	Compattazione di polveri di elettroliti a stato solido come solfuri, ossidi e alogenuri in strati di separatore sottili e privi di difetti.	Elimina vuoti e microfessure, massimizzando la conducibilità degli ioni di litio attraverso le interfacce.
Lavorazione di ceramiche avanzate	Preparazione di corpi verdi uniformi da polveri grezze di allumina, zirconia e nitruro di silicio prima della sinterizzazione ad alta temperatura.	Previene deformazioni, ritiro non uniforme e fessurazioni strutturali interne durante i processi termici.
Composti energetici ed esplosivi	Compressione controllata di sostanze chimiche reattive e composti in polvere energetici in un ambiente protetto.	Ottiene formulazioni di densità precise in sicurezza, minimizzando i rischi di attrito e elettrostatici.
Formulazioni farmaceutiche	Compattazione di miscele farmaceutiche complesse, compresse multi-attive e composti medici a lento rilascio.	Garantisce una densità strutturale esatta e velocità di dissoluzione uniformi per una precisione di dosaggio superiore.
Metallurgia delle polveri e leghe	Consolidamento di polveri di metalli refrattari duri, matrici di leghe e componenti per utensili in carburo.	Migliora notevolmente la resistenza del corpo verde e la densità del materiale, riducendo la lavorazione post-sinterizzazione.
Fabbricazione di materiali target	Fabbricazione di target per sputtering per deposizione fisica da vapore (PVD) ultra-puri e ad alta densità per la produzione di semiconduttori.	Garantisce una uniformità di densità completa, prolungando la durata del target e la consistenza della deposizione.

Parametro tecnico	Specifica metrica / Valore
Modello apparecchiatura	PWDC
Intervallo operativo di tonnellaggio	0,0 - 40,0 tonnellate (Regolabile)
Specifiche pistone / cilindro	Φ130 mm (Lega premium cromata)
Struttura portante	Design monolitico senza guarnizioni (Prevenzione perdite)
Risoluzione visualizzazione pressione	0,1 tonnellate
Interfaccia di controllo	Pannello touchscreen colorato resistivo da 4,3 pollici
Corsa massima pistone	50 mm (T)
Protezione operatore standard	Involucro in plexiglass infrangibile ad alto impatto
Modalità di pressurizzazione	Rampa programmata completamente automatica / Rampa lenta manuale
Calcoli pressione	Conversione automatica intelligente in MPa in base alla geometria
Sistema colonne di guida	Telaio di allineamento parallelo robusto a 4 colonne
Protezione di sicurezza del sistema	Protezione attiva elettronica di rilascio pressione per sovraccarico

Parametro tecnico	Specifica metrica / Valore
Controllo pressurizzazione lenta	Velocità di rampa e velocità di decompressione regolabili tramite programma
Tolleranza temperatura di esercizio	10°C - 40°C
Configurazione camera A (300 MPa)	Dimensioni campione: Φ 40 mm x 150 mm (M x N)
Configurazione camera B (500 MPa)	Dimensioni campione: Φ 30 mm x 150 mm (M x N)
Potenza nominale	500 Watt (Configurabile per monofase 220V o 110V)
Dimensioni nette apparecchiatura (L x P x A)	355 mm x 450 mm x 710 mm
Dimensioni imballo spedizione	725 mm x 620 mm x 890 mm (In casse di legno)